

發明專利說明書

(本說明書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※ 申請案號： 95140186

※ 申請日期： 95.10.31.

※IPC 分類： A43B7/28

一、發明名稱：(中文/英文)

足部平衡墊片及其使用方法

二、申請人：(共1人)

姓名或名稱：(中文/英文)

曾讚育

代表人：(中文/英文)

住居所或營業所地址：(中文/英文)

台北市天母東路8巷21號2樓之13

國 籍：(中文/英文)

中華民國

三、發明人：(共2人)

姓 名：(中文/英文)

1. 曾讚育

2. 林明德

國 籍：(中文/英文)

1與2均中華民國

四、聲明事項：

無

發明專利說明書

(本說明書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※ 申請案號： 95140186

※ 申請日期： 95.10.31.

※IPC 分類： A43B⁷/₂₈

一、發明名稱：(中文/英文)

足部平衡墊片及其使用方法

二、申請人：(共1人)

姓名或名稱：(中文/英文)

曾讚育

代表人：(中文/英文)

住居所或營業所地址：(中文/英文)

台北市天母東路8巷21號2樓之13

國 籍：(中文/英文)

中華民國

三、發明人：(共2人)

姓 名：(中文/英文)

1. 曾讚育

2. 林明德

國 籍：(中文/英文)

1與2均中華民國

四、聲明事項：

無

九、發明說明：

【發明所屬之技術領域】

本發明係一種足部平衡墊片，尤指一種放置於鞋內特定位置，使人們於穿鞋時減少鞋底干擾之墊片設計。

【先前技術】

隨著經濟的發達，現代人對於物質生活的要求也越來越高，其中人們對於穿著鞋子時之舒適感要求亦越來越高，目前市面上生產銷售的鞋子，主要訴求為軟底的氣墊鞋或符合足部形狀的鞋子，但由於兩下肢長短有別，柔軟的鞋底往往會使受力較大的一側下肢，陷下去較多，而使身體關節產生不適當的變化，而符合足部形狀的鞋子，又會增加不必要的足底干擾，造成足部變形，因此足部醫師以矯正鞋墊來改變這些變化，糾正不良步態以改善身體結構，但不一定得到理想的效果，且價格昂貴，導致除非具有嚴重足部變形之人，否則將不會特別去穿著該矯正鞋墊。

【發明內容】

有鑑於前述目前穿鞋造成的困擾，為減少因穿鞋可能造成的傷害，而提出新的理論和設計，藉由簡單的方式，改善人們穿鞋的困擾，使人們足部感覺舒服又不受傷害且價格便宜。

因此，本發明之主要目的係為提供一種足部平衡墊

片，係可改變足部之生物力學，進而改變足底受力之分配，達到身體結構能自我調整為目的，減少足底與地面受力面積，而對足底構成穩固的三點支撐。

為達到上述發明目的，本發明所採用之主要技術手段係令一足部平衡墊片於同一面上具有至少一第一平面與一第二平面，該第二平面係成水平或是沿第一平面邊緣形成一向外傾斜角度，其中該第一平面上具有一支撐部。

使用時，係將該足部平衡墊片放置在鞋內對應使用者之腳跟或是更進一步以另一足部平衡墊片置於鞋內對應前腳掌，而令該第一平面係直接抵掣在使用者之足跟下方與其前腳掌下方，且此一足部平衡墊片上設有一凸點，且有槓桿支點作用，可平衡腳掌內側與外側的受力，亦可平衡腳跟與腳掌的受力，當足部踩踏在上述之足部平衡墊片上時，將受該足部平衡墊片之支撐部之支撐，而減少與足底接觸的方法，因而能減少足底受力面積，當受力面積減少，即對足底形成三點支撐，腳跟和腳掌自然不易內翻或外翻。

前述足部平衡墊片之支撐部係高於第一平面及第二平面。

前述足部平衡墊片之支撐部與第一平面等高，且支撐部之硬度大於第一平面。

前述足部平衡墊片係形成一橢圓形。

前述第一平面與第二平面係分別形成半橢圓形。

前述足部平衡墊片係形成近似”人”字型。

本發明之另一目的係提供一種上述足部平衡墊片之使用方法，係包括：

提供至少一如上所述之足部平衡墊片；及

將該足部平衡墊片放置在鞋內，而位於與使用者腳跟及／或是前腳掌相應之位置上。

前述足部平衡墊片可放置在一鞋墊上。

前述足部平衡墊片可放置在鞋子內部底面。

藉此，將可輔助使用者足部之穩定，進一步避免使用者之腳跟和腳掌之內翻或外翻。

【實施方式】

請參閱第一圖所示，係為本發明第一較佳實施例之平面圖。本發明係令一足部平衡墊片（10）於同一面上具有至少一第一平面（11）與一第二平面（12），該第二平面（12）係呈水平（如第二圖所示），其中該第一平面（11）上係具有一支撐部（110），該支撐部（110）係等於該第一平面（11）與第二平面（12）而使其為受力點，於本實施例中，該足部平衡墊片（10）係形成一橢圓形，且該第一平面（11）與第二平面（12）係分別形成半橢圓形，且該第二平面（12）係呈水平，此外，該支撐部（110）係與該第一平面（11）及該第二平面（12）等高，其係為硬質材料所構成。

請再參閱第三圖所示，係為本發明第二較佳實施例之剖面圖。於本實施例中，該第二平面（12）係沿該第一

平面 (1 1) 之邊緣向外傾斜一角度，該支撐部 (1 1 0) 係定義自該第一平面 (1 1) 的最高點，藉以對足底構成支撐。

請再參閱第四圖所示，係為本發明第三較佳實施例之平面圖。於本實施例中，該足部平衡墊片 (1 0 a) 係形成近似”人”字型，且該第二平面 (1 2 a) 之邊緣係向外傾斜一角度，該足部平衡墊片 (1 0 a) 具有兩第一平面 (1 1 a) (1 1 b) ，其中一第一平面 (1 1 b) 係位該第二平面 (1 2 a) 上，且該支撐部 (1 1 0 b) 係高於該第一平面 (1 1 b) ，另一支撐部 (1 1 0 a) 與其上的第一平面 (1 1 a) 等高，且為硬質材料組成。

請參閱第五圖與第六圖所示，係為本發明使用在足部之示意圖與側視圖。當使用者之足部踩踏在該足部平衡墊片 (1 0) (1 0 a) 上，係令該第一平面 (1 1) 之支撐點 (1 1 0) 對應於使用者之腳跟中心點往腳指方向與足弓接近處而為腳跟受力位置，而該足部平衡墊片 (1 0 a) 係設置在符合前腳掌受力之位置上，該支撐部 (1 1 0 a) 係相對於使用者之蹠骨頭下方，且另一支撐部 (1 1 0 b) 係對應至使用者之第一蹠骨與第二蹠骨接近足弓處，於本實施例中，係為一凸點，該支撐部 (1 1 0 b) 具有槓桿支點和按摩湧泉穴的作用。

此外，本發明之使用方法，係包括：

提供至少一足部平衡墊片；及

將該足部平衡墊片放置在鞋內，而位於與使用者腳跟

及／或是前腳掌相應之位置上。使用者欲使用該足部平衡墊片時，係將該足部平衡墊片放置在鞋內，其中鞋子可為各式鞋子，如：皮鞋、布鞋或是涼鞋等，或是將該足部平衡墊片設置或形成在一鞋墊上後，再放入鞋內，如第七圖所示，係為本發明實施在一拖鞋上之示意圖。於本實施例中係以拖鞋作為說明，但不用以限制本發明，使用者係將該足部平衡墊片（10）（10a）係分別設置在拖鞋鞋面上且與使用者之足跟與前腳掌之相應位置。

綜上所述，當使用者將足部踩踏在上述之足部平衡墊片上時，由於該足部平衡墊片之支撐部將會支撐使用者之足部，因而能減少足底受力面積，當受力面積減少後，足底形成三點鼎立，腳跟和腳掌自然不易內翻或外翻。

【圖式簡單說明】

第一圖：係為本發明第一較佳實施例之平面圖。

第二圖：係為本發明第一較佳實施例之剖面圖。

第三圖：係為本發明第二較佳實施例之剖面圖。

第四圖：係為本發明第三較佳實施例之平面圖。

第五圖：係為本發明使用在足部之示意圖。

第六圖：係為本發明使用在足部之側視圖。

第七圖：係為本發明實施在一拖鞋之示意圖。

【主要元件符號說明】

（10）（10a）足部平衡墊片

（11）（11a）（11b）第一平面

200819073

(1 1 0) (1 1 0 a) (1 1 0 b) 支 撐 部

(1 2) (1 2 a) 第 二 平 面

五、中文發明摘要：

本發明係一種具有足部平衡作用之墊片，係在一足部平衡墊片的一表面上至少定義出一第一平面與一第二平面，該第二平面係呈水平或是略具有一傾斜角度，其中該第一平面上具有一支撐部，該支撐部係高於或等於第一平面與第二平面，當該足部平衡墊片放置於鞋內的特定位置，係可縮小足底與地面之接觸面積，使足底產生三點鼎立的效果，改善足部內翻或外翻的情形。

六、英文發明摘要：

七、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第(一)圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

(1 0) 足部平衡墊片

(1 1) 第一平面

(1 1 0) 支撐點

(1 2) 第二平面

八、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：

十、申請專利範圍：

1．一種足部平衡墊片，係令一足部平衡墊片於同一面上具有至少一第一平面與一第二平面，該第二平面係成水平或是沿第一平面邊緣形成一向外傾斜角度，其中該第一平面上具有一支撐部。

2．如申請專利範圍第1項所述之足部平衡墊片，該支撐部係高於第一平面及第二平面。

3．如申請專利範圍第1項所述之足部平衡墊片，該支撐部係與足部平衡墊片的第一平面等高，且支撐部之硬度大於該足部平衡墊片。

4．如申請專利範圍第2或3項所述之足部平衡墊片，該足部平衡墊片係形成一橢圓形。

5．如申請專利範圍第4項所述之足部平衡墊片，該第一平面與第二平面係分別形成半橢圓形。

6．如申請專利範圍第1項所述之足部平衡墊片，該足部平衡墊片係形成近似”人”字型。

7．如申請專利範圍第6項所述之足部平衡墊片，該足部平衡墊片於同一面上具有兩第一平面，其中一第一平面係位該第二平面上。

8．如申請專利範圍第7項所述之足部平衡墊片，位於該第二平面上之第一平面的支撐部係為一凸點。

9．如申請專利範圍第7項所述之足部平衡墊片，該支撐部係高於第一平面及第二平面。

10．如申請專利範圍第7項所述之足部平衡墊片，

該支撐部係埋入於足部平衡墊片內而與第一平面等高，且支撐部之硬度大於該足部平衡墊片。

1 1．一種使用如申請專利範圍第 1 項所述之足部平衡墊片以穩定足部平衡之方法，係包括：

提供至少一如申請專利範圍第 1 項所述之足部平衡墊片；及

將該足部平衡墊片放置在鞋內，而位於與使用者腳跟及／或是前腳掌相應之位置上。

1 2．如申請專利範圍第 1 1 項所述之方法，該足部平衡墊片係設置或形成在一鞋墊上。

1 3．如申請專利範圍第 1 1 項所述之方法，該足部平衡墊片係設置在鞋子內部底面。

十一、圖式：

如次頁

該支撐部係埋入於足部平衡墊片內而與第一平面等高，且支撐部之硬度大於該足部平衡墊片。

1 1．一種使用如申請專利範圍第 1 項所述之足部平衡墊片以穩定足部平衡之方法，係包括：

提供至少一如申請專利範圍第 1 項所述之足部平衡墊片；及

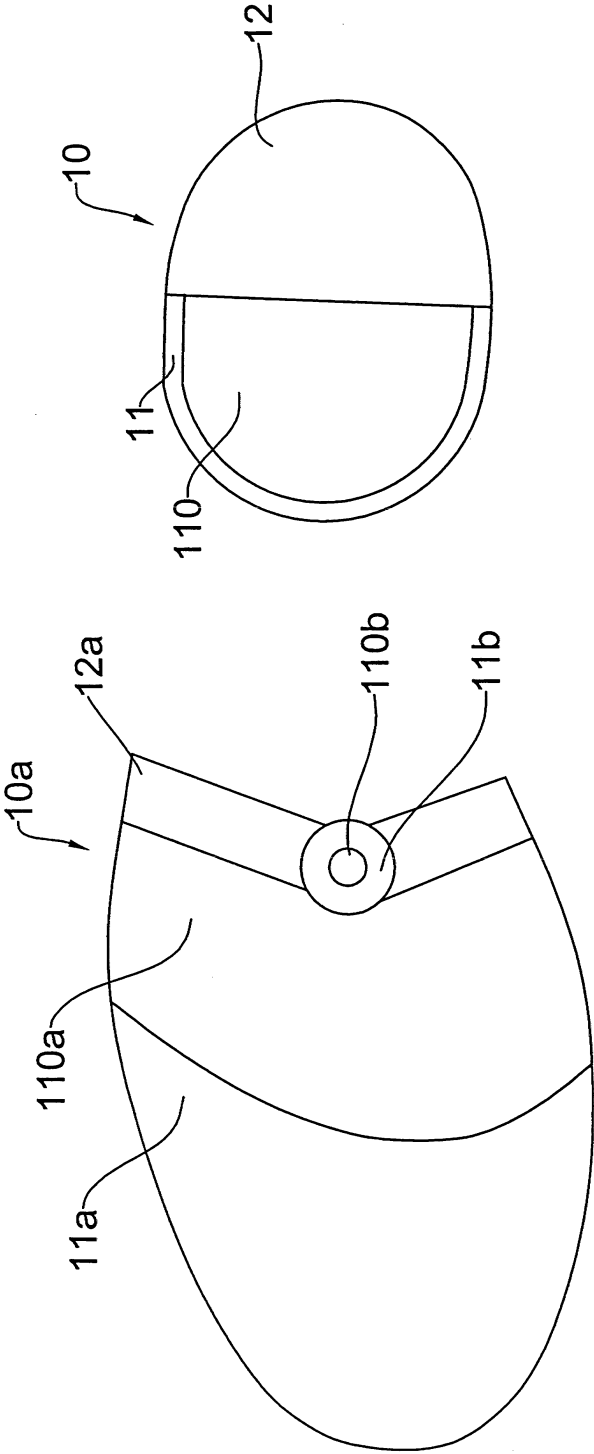
將該足部平衡墊片放置在鞋內，而位於與使用者腳跟及／或是前腳掌相應之位置上。

1 2．如申請專利範圍第 1 1 項所述之方法，該足部平衡墊片係設置或形成在一鞋墊上。

1 3．如申請專利範圍第 1 1 項所述之方法，該足部平衡墊片係設置在鞋子內部底面。

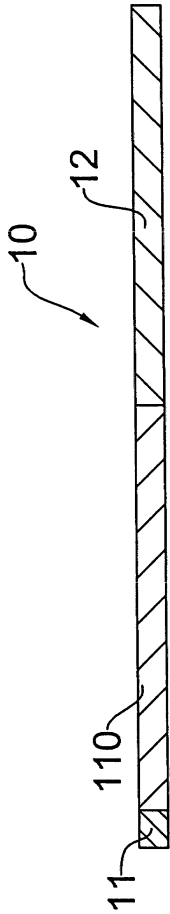
十一、圖式：

如次頁

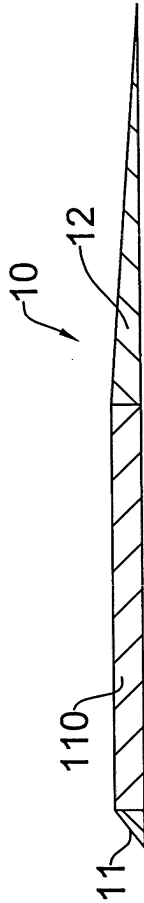


第一圖

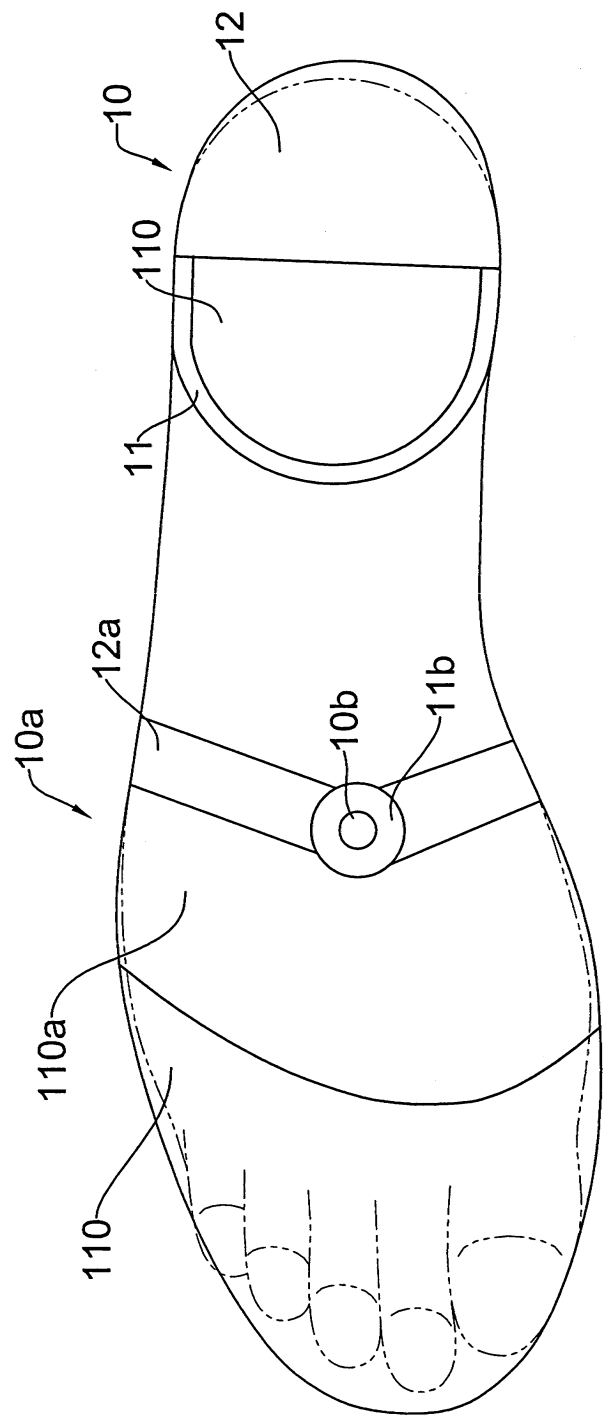
第四圖



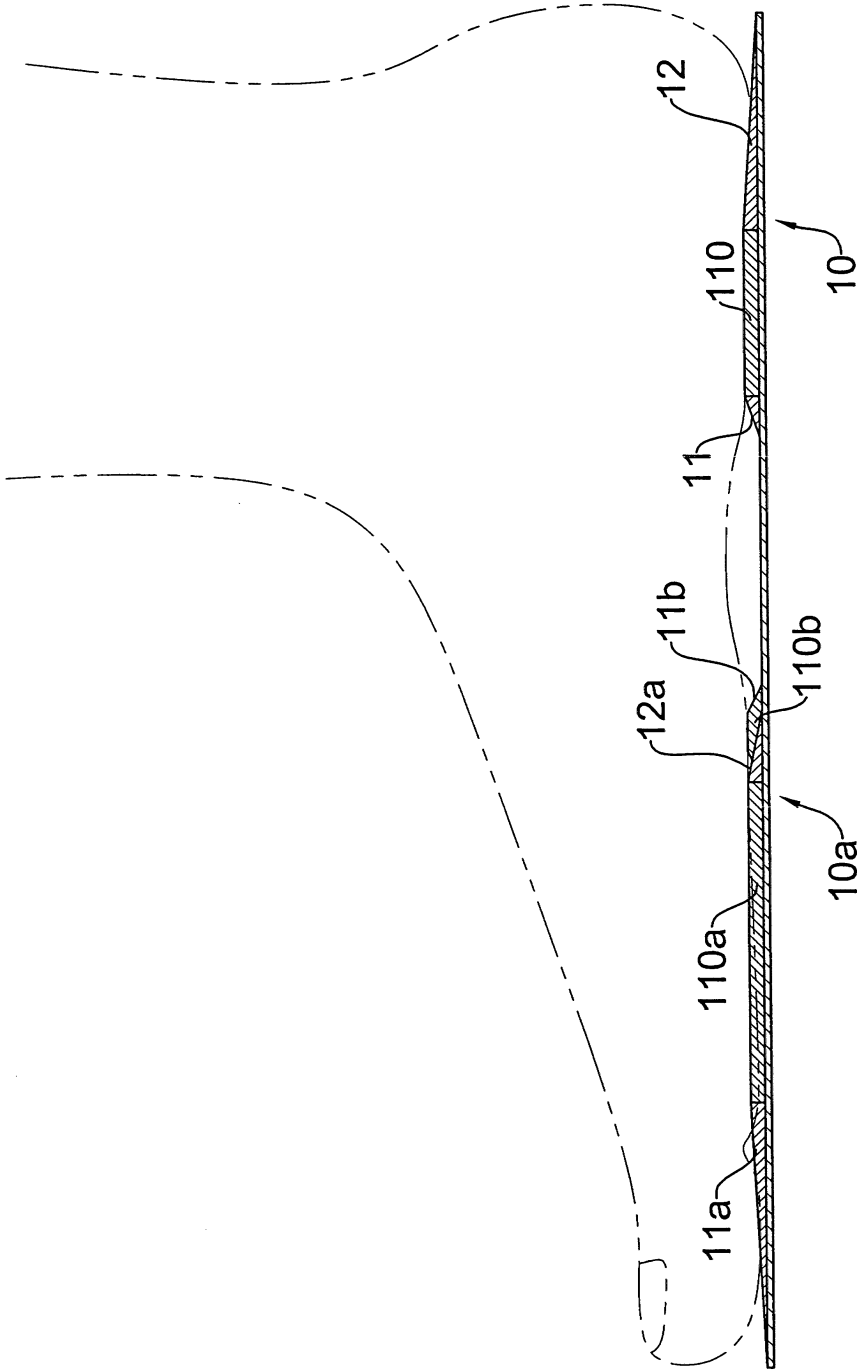
第二圖



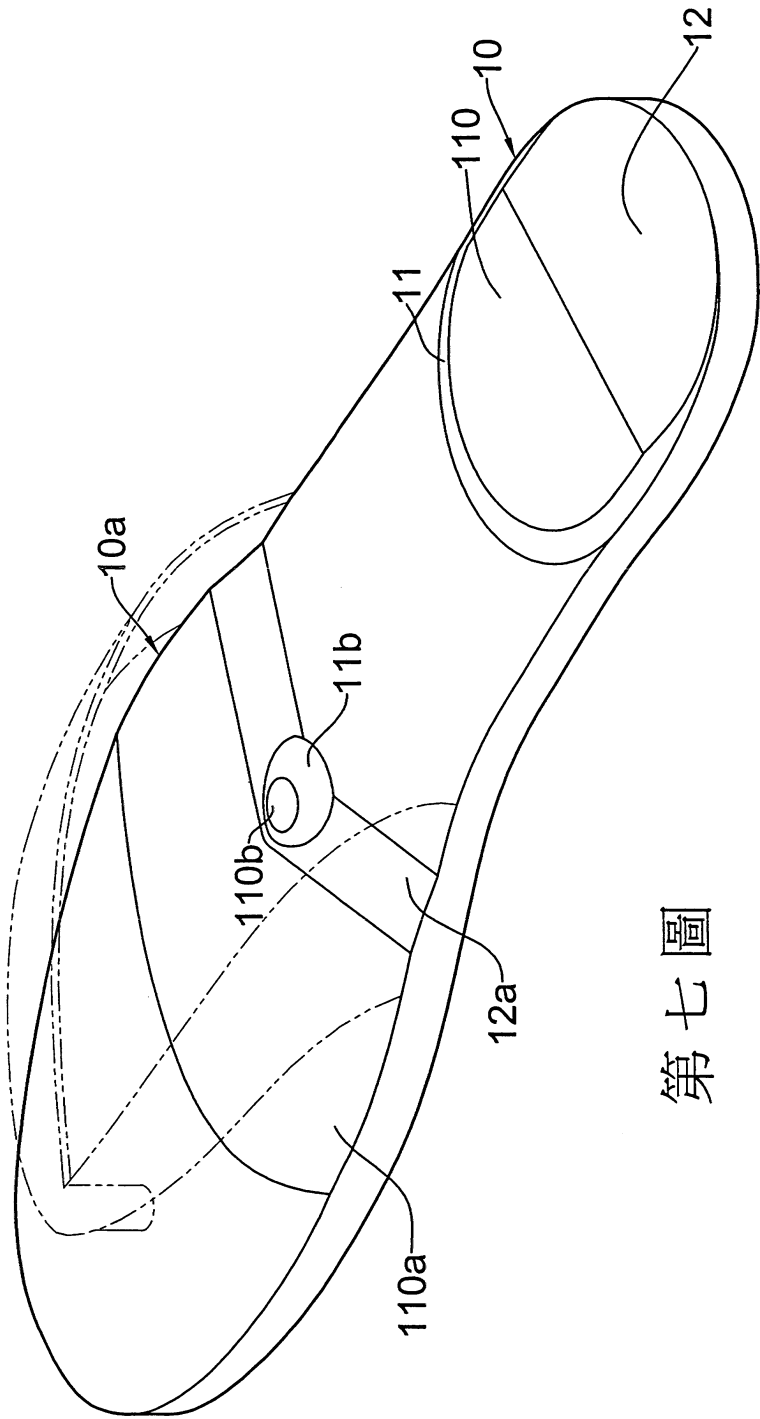
第三圖



第五圖



第六圖



第七圖

五、中文發明摘要：

本發明係一種具有足部平衡作用之墊片，係在一足部平衡墊片的一表面上至少定義出一第一平面與一第二平面，該第二平面係呈水平或是略具有一傾斜角度，其中該第一平面上具有一支撐部，該支撐部係高於或等於第一平面與第二平面，當該足部平衡墊片放置於鞋內的特定位置，係可縮小足底與地面之接觸面積，使足底產生三點鼎立的效果，改善足部內翻或外翻的情形。

六、英文發明摘要：

七、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第(一)圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

(1 0) 足部平衡墊片

(1 1) 第一平面

(1 1 0) 支撐點

(1 2) 第二平面

八、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：